



即時發表

經辦代理:

David Moreno (大衛穆銳農)

Open Sky Communications

電話: +1-415-519-3915

電郵: dmoreno@openskypr.com

EBEAM INITIATIVE 調查顯示光罩市場的前景將持續樂觀

第十屆業界精英調查結果將於 SPIE 光罩技術會議之線上活動中公佈

聖荷西, 加州, 美國, 二零二一年九月二十八日—eBeam Initiative, 一個致力於推動和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體, 今天宣佈第十屆年度 eBeam Initiative 業界精英調查順利完成。任職於橫跨整個半導體生態系統不同公司的 44 位業界精英參與了今年的調查; 他們代表了整個半導體生態系統的公司—包括光罩, 電子設計自動化軟體 (EDA), 晶片設計, 儀器設備, 材料, 製造和研發等領域。

業界精英調查中百分之七十二的參與者預計 2021 年光罩市場的總額與 2020 年相比會有所增加, 而百分之七十四的參與者相信 EUV 會驅動光罩的增長。問卷參與者列出 EUV 仍是購買多重電子束光罩刻寫機的主要動機。百分之九十的回覆相信多重電子束光罩刻寫機市場會在今後三年持續增長, 同時, 要購買鐳射光罩刻寫機和可變形束電子束(VSB)光罩刻寫機的意向也較去年的調查增加。製造曲線圖形光罩的信心也比去年高, 百分之七十一的回覆表示先進光罩廠至少可以生產有限數量的曲線圖形先進光罩。

業界精英調查結果的完整報告將於今晚的 eBeam Initiative 線上會議中, 由專家小組對其講解討論。調查結果的完整報告可於會後由此連結下載 www.ebeam.org。

業界精英調查其它要點有 (此調查於 2021 年 7 月完成) :

- 百分之九十五的回覆相信逆向微影技術 (ILT) 現正用於晶片製造。
- 預計曲線圖形技術用在 193i 光罩的數量比用在 EUV 光罩的數量要多。
- 光罩檢測 (mask inspection) 和光罩生產設施(infrastructure)被列為製造曲線圖形光罩的兩大疑慮。
- 但是, 只有百分之四的回覆認為以上對曲線圖形的疑慮是難以逾越的。



EBEAM INITIATIVE PUBLISHES RESULTS OF 10TH ANNUAL LUMINARIES SURVEY.....Page 2 of 2

“十年來，每年 eBeam Initiative 主辦的業界精英調查為我們提供了一個了解業界具影響力人士如何看待半導體工業主要趨勢的寶貴視角，” eBeam Initiative 的主辦管理公司 D2S 的執行長藤村先生 (Aki Fujimura) 表示，“去年的調查結果顯示，即便在新冠疫情 (COVID-19) 影響下，大家對光罩市場的前景預測仍然正面，今年調查結果則更為樂觀。在調查中尤其值得注意的是業界精英對曲線光罩製造的高度信心。這種信心也反應在今年 SPIE 光罩技術會議上，有史以來第一次設立了一個以曲線光罩為主題的議程，顯示對曲線光罩圖形在先進半導體製造中的重要性有越來越多的肯定。”

關於 eBeam Initiative (電子束倡議團)

eBeam Initiative 是一個致力於推廣和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體；為有關電子束技術的教育和促進活動提供相應的論壇。The eBeam Initiative 的目標是增加電子束技術應用在半導體製造各領域中的投資；降低電子束技術應用的障礙，能夠使更多積體電路設計完成，並且更快投進市場成為可能。會員公司，涵蓋整個半導體生態系統，包括：aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; AseltaNanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; Fraunhofer IPMS; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; Hitachi High-Tech Corporation; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMIC; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Inc.; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS. eBeam Initiative 面向和歡迎所有電子工業的公司和協會加盟。細節請查看 www.ebeam.org.

###